



(Translation)

Reference No.: 00P086SM Dispatch No. 323345 Dispatch date: September 16, 2003

NOTICE OF REASONS FOR REJECTION

Number of patent application: Patent Application No. 2000-117771
Drafted: September 9, 2003
Patent Office, Examiner: Keiji Fujiwara 8406 4G00
Agent of the applicant: Yoshihiro Shimizu and two others
Articles applied: Article 29, clause 1, Article 29, clause 2, Article 37

This application is considered to be rejected for the following reasons.
If there is any opinion against this, kindly submit a written opinion within 60 days from the dispatch date of this notice.

REASONS

A. This application does not comply with the requirements under provision of Article 37 of the Patent Law in the following points.

Remarks

The invention described in claim 1 on which claims 2 to 6 and claims 7 to 11 are dependent is merely a known feature (in short, see Patent Application Laid-open No. 60-243843, Patent Application Laid-open No. 56-156760, Patent Application Laid-open No. 06-158285, etc.). After the feature described in claim 1 is removed, the main subjects of the respective inventions in claim 2 itself, claim 12 itself and claim 7 itself are different, and the problems to be solved by said main subjects of the inventions are different.

In claim 16, as the elements of the vapor-depositing material are not limited except for the content of hydrogen, the main subjects of the inventions in claims 1 to 15, claims 16 to 20 and claim 16 are different. Also, the

problems to be solved by said main subjects of the inventions are different.

Therefore, it is not recognized that the inventions have relevance stipulated in Article 37, item 1 and item 2 of the Patent Law.

Further, it is not recognized that the respective inventions have any relevance stipulated in Article 37, item 3, item 4 and item 5 of the Patent Law.

As this application violates the provision under Article 37 of the Patent Law, the inventions according to other claims than claims 1 to 6, claims 12 to 15 and claims 17 to 20 have not been examined regarding other requirements than those of Article 37 of the Law.

B. The inventions according to the following claims of this application cannot be patented under Article 29, clause 1, item 3 of the Patent Law since the inventions were the inventions described in the following distributed publications or the inventions available to the public through telecommunication in Japan or foreign countries before filing of this application.

C. The inventions according to the following claims of this application cannot be patented under Article 29, clause 2 of the Patent Law since the inventions could be made easily by a person having a usual knowledge in the technical field belonging to the inventions on the basis of the inventions described in the following distributed publications or the inventions available to the public through telecommunication in Japan or foreign countries before filing of this application.

REMARKS (see LIST OF CITED REFERENCES regarding cited references)

- Reasons 1 and 2
- Claim 1
- Cited references 1 and 2
- Note

In the respective inventions described in Cited references 1 and 2, a vapor-depositing material is evaporated in a state in which a vapor deposition

controlling gas has been supplied.

Cited reference 1: when a vapor-depositing film containing Tb as an easily oxidizable vapor-depositing material is formed on the surface of the plastic substrate, vapor deposition is carried out by supplying an H₂ or H₂+Ar gas as a vapor deposition controlling gas.

Example of prior art in Cited reference 2: it is described that vapor deposition is carried out in a state in which a solid solution H₂ gas has been contained in the Al wire.

- Reason 2
- Claims 2 to 6 and 12 to 14
- Cited references 2 and 3
- Note

It is described in Cited reference 2 that treatment is carried out under a degree of vacuum equal to or higher than 10⁻³ Pa. It is described in Cited reference 3 that in order to control oxidation, the ratio of hydrogen gas in the gas should be 90 vol% or more. Therefore, it is recognized that it can be easily expected to make the molar ratio of hydrogen to oxygen 10 or more. Also, it is recognized that the amount of hydrogen gas can be suitably adjusted depending on the degree of quality required for a film.

- Reason 2
- Claims 11 to 20
- Cited references 1 to 3
- Note

In a vapor deposited film, a special feature as the invention of “product” specified by the production process described in claim 1 is not recognized.

With respect to the invention according to the claim(s) other than the

claim (s) pointed out in this Notice of Reasons for Rejection, any reason for rejection has not been found at present. If new reasons for rejection are found, the reasons for rejection will be notified. (As mentioned in the above Reason A, claims 7 to 11 and 16 have not been examined regarding other requirements than those of Article 37 of the Patent Law).

LIST OF CITED REFERENCES

1. Patent Application Laid-open No. 60-243843
2. Patent Application Laid-open No. 60-092466
3. Patent Application Laid-open No. 06-158285

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2 0 0 0 - 1 1 7 7 7 1
起案日	平成 1 5 年 9 月 9 日
特許庁審査官	藤原 敬士 8 4 0 6 4 G 0 0
特許出願人代理人	清水 善▲廣▼ (外 2 名) 様
適用条文	第 2 9 条第 1 項、第 2 9 条第 2 項、第 3 7 条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

A. この出願は、下記の点で特許法第 3 7 条に規定する要件を満たしていない。

記

請求項 2 - 6 及び請求項 7 - 1 1 が引用している請求項 1 に記載された発明は、周知の構成（要すれば、特開昭 6 0 - 2 4 3 8 4 3 号公報、特開昭 5 6 - 1 5 6 7 6 0 号公報、特開平 0 6 - 1 5 8 2 8 5 号公報等参照。）にすぎず、請求項 1 に記載された構成を除いた、請求項 2 自体、請求項 1 2 自体と請求項 7 自体との各発明の主要部及び発明が当該主要部に基づく解決しようとする課題は相違するものである。

また請求項 1 6 は、水素願憂慮以外の蒸着材料における成分が何ら限定されていないことから、請求項 1 - 1 5 及び請求項 1 6 - 2 0 と請求項 1 6 との発明の主要部は相違しており、また、当該主要部に基づく発明が解決しようとする課題も相違したものとなる。

したがって、特許法第 3 7 条、第 1 号、第 2 号に規定する関係を有すると認められない。

さらに、各発明は、特許法第 3 7 条第 3 号、第 4 号、第 5 号に規定する関係のいずれを満たすものとも認められない。

この出願は特許法第 3 7 条の規定に違反しているので、請求項 1 - 6、1 2 - 1 5、1 7 - 2 0 以外の請求項に係る発明については同法第 3 7 条以外の要件についての審査を行っていない。

B. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆

に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

C. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・理由の1, 2
- ・請求項1
- ・引用文献等1, 2
- ・備考

引用文献1, 2に記載された各発明は、蒸着制御ガスを供給した状態で蒸着材料を蒸発させるものである。

引用文献1; 易酸化性蒸着材料として、Tbを含む蒸着膜をプラスチック基板の表面に形成する際に、蒸着制御ガスとしての、 H_2 または $H_2 + Ar$ ガスを供給して蒸着を行っている。

引用文献2の従来例; A1線の中に固溶 H_2 ガスが混在された状態で蒸着を行うことが記載されている。

- ・理由の2
- ・請求項2-6, 12-14
- ・引用文献等2, 3
- ・備考

真空度を $10^{-3} Pa$ 以上で処理を行うことが引用文献2に記載されており、また、酸化を制限するためには、ガス中の水素ガスの割合を90vol%以上とすべきことが引用文献3に記載されていることから、水素/酸素のモル比を10以上とすることも容易に想到しうるものと認められる。また、被膜の要求する品質の程度に応じて、水素ガス量は適宜調節されうるものと認められる。

- ・理由の2
- ・請求項11-20
- ・引用文献等1-3
- ・備考

蒸着皮膜として、請求項1に記載された製造方法に特定された「物」の発明としての格別な構成が認められない。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。（但し、請求項7-11, 16については、上記拒絶の理由Aのように特許法37条以外の審査を行っていない。）

引用文献等一覧

1. 特開昭60-243843号公報
2. 特開昭60-092466号公報
3. 特開平06-158285号公報

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 I P C 第7版
 C 2 3 C 1 4 / 0 0 - 5 8

・先行技術文献

4. 特開昭56-156760号公報
 5. 特公昭47-007123号公報
 6. 特公昭33-004309号公報
 7. 特開平10-106815号公報
 5. 特開平06-116717号公報; A l, T i, Z n等ワイヤー状原料
- この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知書の内容に関するお問い合わせ先

特許庁 特許審査第三部 無機化学

審査官 藤原敬士

電話 03-3581-1101

内線 3414-3416

FAX 03-3580-6905